SG9705040-7

RTMP COPY

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:		(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:
H01L 21/00	A1	WO 96/36068
		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 14. November 1996 (14.11.96)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP96/01813

(22) Internationales Anmeldedatum: 2. Mai 1996 (02.05.96)

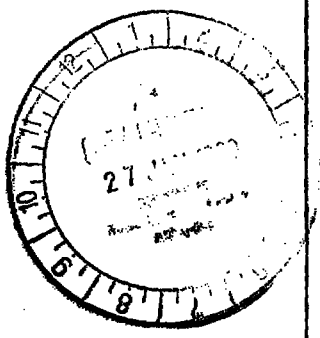
(30) Prioritätsdaten:
195 17 573.5 12. Mai 1995 (12.05.95) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten ausser US)*: STEAG MICROTECH GMBH [DE/DE]; Carl-Benz-Strasse 10, D-72124 Pliezhausen (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: DENZLER, Ludwig [DE/DE]; Westliche 45, D-75210 Keltern (DE). HARMS-JANSSEN, Helmuth [DE/DE]; Am Gänsberg 32, D-75038 Oberderdingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, CZ, JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht
Mit internationalem Recherchenbericht.
Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.



(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR WET-PROCESSING SUBSTRATES IN A VESSEL

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR NASSBEHANDLUNG VON SUBSTRATEN IN EINEM BEHÄLTER

(57) Abstract

Proposed is a method for wet-processing substrates in a vessel into which a liquid is fed and is removed again through an overflow device. The method is particularly simple to carry out if the overflow device floats on the liquid and descends and/or rises as the liquid surface descends and/or rises. No mechanical devices are needed to raise the substrates and remove them from the liquid. Also proposed are devices for the wet-processing of substrates by the method proposed.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zur Naßbehandlung von Substraten mit einem Behälter, in den ein Fluid eingeleitet und über eine Überlaufeinrichtung abgeführt wird, ergibt sich ein besonders einfacher Verfahrensablauf mit einfachen Mitteln, wenn die Überlaufeinrichtung auf dem Fluid schwimmt und sich zusammen mit der Fluid-Oberfläche absenkt und/oder anhebt. Mechanische Einrichtungen zum An- und Herausheben der Substrate aus dem Fluid sind nicht erforderlich. Vorrichtungen zur Naßbehandlung von Substraten für die Durchführung des Verfahrens sind angegeben.

